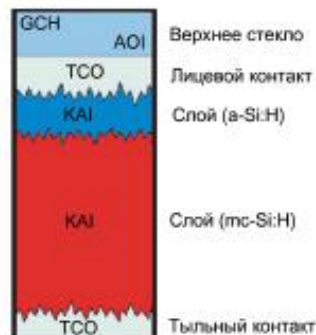
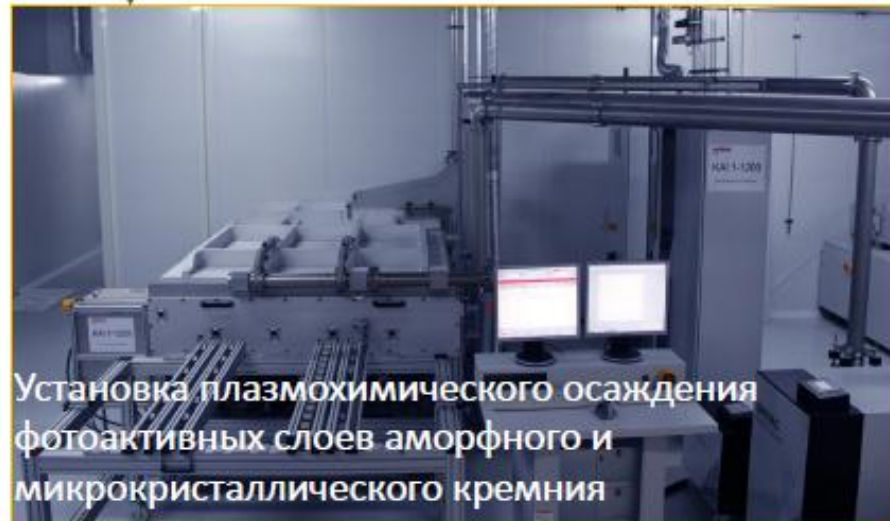
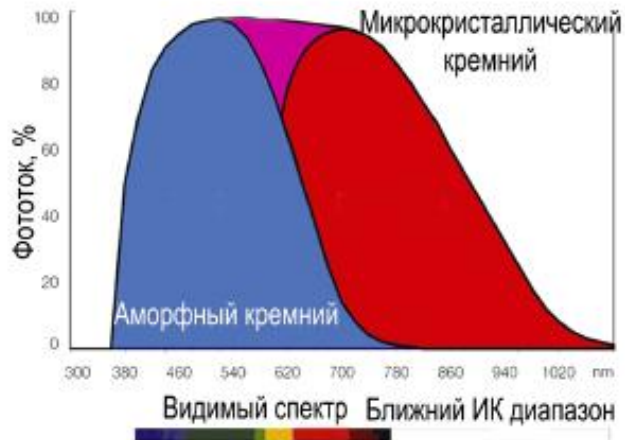




Установка осаждения кремниевых слоев KAI 1-1200



Осаждение фотоактивных слоев микроморфного кремниевого солнечного модуля

Назначение:



Установка осаждения кремниевых слоев KAI 1-1200

Параметры осаждения:

Метод - плазмохимическое осаждение

Частота разряда (RF frequency) - 40,7 МГц

Используемые газы – SiH_4 , GeH_4 , H_2 , $\text{H}_2/\text{B}(\text{CH}_3)_3$ (2%), H_2/PH_3 (0,5%), CH_4 , CO_2 , H_2O (пар), NF_3 , Ar, N_2 (технологический газ)

Возможно осаждение кремний-германиевых слоев

Рабочая температура – от 160 до 200 °С

Рабочее давление – 5×10^{-2} мбар

Скорость осаждения – от 1,8 до 5,2 Å/с

Максимальная площадь осаждения - 1,1x1,3 м²

Варьирование параметров позволяет получать аморфные и микрокристаллические тонкие пленки